

2025年7月期 中間期 決算説明会

2025年3月13日(木)

サムコ株式会社

証券コード:6387

25/7月期 中間期の実績

(2024.8.1 ~ 2025.1.31)

25/7月期中間期 業績ハイライト

過去最高

売上高	営業利益	経常利益	中間期純利益
41.2億円 (+0.4%)	9.9億円 (△2.2%)	10.1億円 (△5.0%)	7.1億円 (△4.4%)

- ❑ 売上高は3期連続で過去最高を更新
- ❑ 営業利益、経常利益、純利益は計画を上回って推移
- ❑ 受注高は42.9億円（前年同期比17.1%増）
- ❑ 受注残高55.3億円（前年同期比11.2%増）

25/7月期中間期(累計) 実績報告

(単位:百万円)

	24/7月期 中間期実績	25/7月期中間期		
		実績	前年同期比	当初計画
売上高	4,105	4,121	0.4 %	4,300
売上総利益	2,052	2,106	2.7 %	2,091
売上高総利益率	50.0 %	51.1 %	—	48.6 %
営業利益	1,012	990	△2.2 %	960
営業利益率	24.7 %	24.0 %	—	22.3 %
経常利益	1,063	1,011	△5.0 %	970
当期純利益	747	714	△4.4 %	660

- ▶ 原材料価格の上昇はあるものの、販売価格の値引き抑制、操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持。

25/7月期中間期 装置別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期中間期		25/7月期中間期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
CVD装置	795	19.4 %	753	△ 5.2 %	18.3 %
エッチング装置	2,363	57.6 %	2,522	6.7 %	61.2 %
洗浄装置	366	8.9 %	223	△ 39.0 %	5.4 %
部品・メンテナンス	580	14.1 %	622	7.2 %	15.1 %
合計	4,105	100.0 %	4,121	0.4 %	100.0 %

【CVD装置】 光導波路などのシリコンフォトリソグラフィの加工用途、半導体レーザー向け(化合物半導体分野)での販売。

【エッチング装置】 通信用の半導体レーザー向け(化合物半導体分野)、高周波フィルター向け(電子部品分野)、欠陥解析(FA=Failure analysis)向け(シリコン半導体分野)での販売。

【洗浄装置】 センサーの加工用途(ヘルスケア関連分野)、LEDの加工用途での販売。

25/7月期中間期 用途別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期中間期		25/7月期中間期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
化合物半導体分野	1,722	42.0 %	1,111	△ 35.5 %	27.0 %
シリコン半導体分野	798	19.5 %	940	17.7 %	22.8 %
電子部品分野	159	3.9 %	645	304.5 %	15.7 %
ヘルスケア関連分野	23	0.6 %	81	251.8 %	2.0 %
その他	821	20.0 %	720	△12.3 %	17.5 %
部品・メンテナンス	580	14.1 %	622	7.2 %	15.1 %
合計	4,105	100.0 %	4,121	0.4 %	100.0 %

【化合物半導体分野】 半導体レーザーなどの通信関連の光デバイス向け、次世代パワーデバイス向けでの販売。

【シリコン半導体分野】 欠陥解析、シリコンフォトニクス向けでの販売。

【電子部品分野】 センサー、高周波フィルター向け等での販売。

25/7月期中間期 目的別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期中間期		25/7月期中間期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
生産用	1,327	32.3 %	1,407	6.0 %	34.1 %
研究開発用	2,197	53.5 %	2,091	△ 4.8 %	50.8 %
部品・メンテナンス	580	14.1 %	622	7.2 %	15.1 %
合計	4,105	100.0 %	4,121	0.4 %	100.0 %

【生産用】 エッチング装置を中心に、通信用の半導体レーザー向け(化合物半導体分野)、高周波フィルター向け(電子部品分野)、欠陥解析向け(シリコン分野)などの幅広い用途での販売が堅調。

【研究開発用】 CVD装置(ALD装置含む)、エッチング装置の化合物半導体分野、電子部品分野での販売が堅調。将来の量産フェーズへの移行に期待。

25/7月期中間期 地域別売上高

(単位:百万円)

	24/7月期中間期		25/7月期中間期		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
(国内)	2,542	61.9 %	2,666	4.9 %	64.7 %
(海外合計)	1,563	38.1 %	1,454	△6.9 %	35.3 %
アジア	1,160	28.3 %	977	△15.8 %	23.7 %
北米	399	9.7 %	343	△13.9 %	8.3 %
欧州	2	0.1 %	124	4381.3 %	3.0 %
その他	0	0.0 %	8	5056.1%	0.2 %
合計	4,105	100.0 %	4,121	0.4 %	100.0 %

- 海外売上高比率 35.3% (通期計画42.1%)。
- アジア市場: 中国472百万円、台湾289百万円、韓国161百万円。

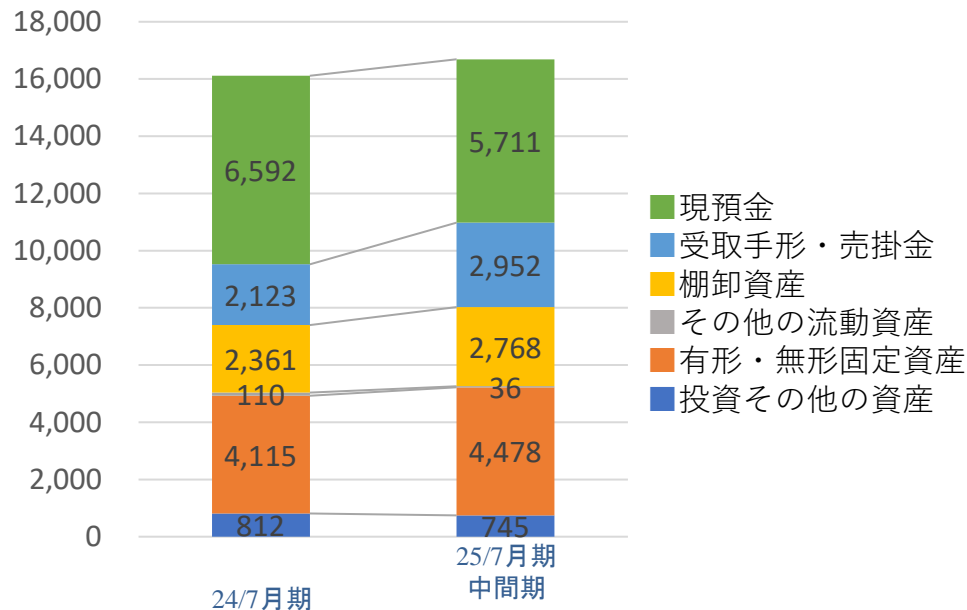
受注環境(受注高、受注残高)の変化



貸借対照表(前事業年度末比)

(単位:百万円)

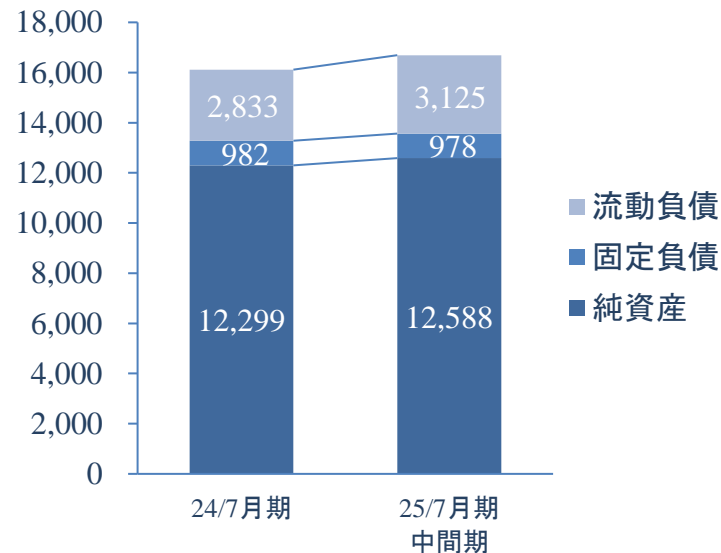
資産



- ・受取手形・売掛金 828百万円増
- ・棚卸資産 406百万円増
- ・現金及び預金 880百万円減

(単位:百万円)

負債・純資産



- ・繰越利益剰余金 353百万円増
- ・買掛金 78百万円増
- ・未払法人税等 36百万円減

キャッシュフロー計算書(前年同期比)

(単位:百万円)

	24/7月期 中間期	25/7月期 中間期	前年同期比	25/7月期 中間期の主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	722	△ 110	△ 833	税引前中間期純利益+1,011、 売上債権及び契約資産の増加額△828 棚卸資産の増加△412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42	△ 395	△ 352	有形固定資産の取得による支出△392
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 382	△ 382	0	配当金の支払△361
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	0	△ 100	—
現金及び現金同等物の増減額	307	△ 889	△ 1,196	—
現金及び現金同等物の期首残高	3,374	4,637	1,263	—
現金及び現金同等物の期末残高	3,681	3,748	67	—

25/7月期 中間期トピックス

(2024.8.1 ~ 2025.1.31)

「先端技術開発棟」2025年春、稼働予定



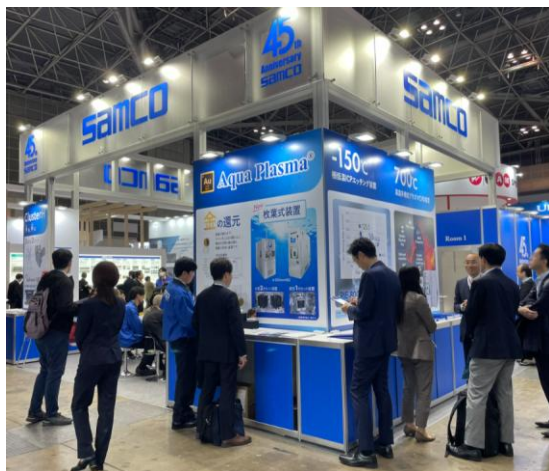
- 先端技術開発棟(京都市伏見区)春始動
- GaNパワー/RFデバイス、GaAs VCSEL、InP Laser、SiCパワーデバイス、MEMS、高周波フィルターなどに向けた技術開発加速
- 生成AIやBeyond 5G市場向けニーズに対応
- 最新の装置、計測機器導入予定
- 研究開発の効率化、迅速化

25/7月期中間期 トピックス



SEMICON Japan 2024出展

- 2024年12月11～13日、東京ビッグサイトにて開催
- 延べ来場者数は103,000人(前年比+21%)



弊社ブースの様子
(東京ビッグサイト)



社員一同

展示会出展予定の情報は[こちら](#)

25/7月期中間期 トピックス



SEMICON Taiwan 2024出展

- 2024年9月4日～6日、台湾にて開催。
- 延べ来場者数は85,000人



SEMICON Europa 2024出展

- 2024年11月12日～15日、ドイツにて開催。
- 延べ来場者数は80,000人



欧州 III-V Lab社に「RIE-400iP」を2台販売



- フランスのIII-V Lab社へICPエッチング装置「RIE-400iP」を2台納入
- III-V Lab社はIII-V 族半導体を用いたフォトニクス・マイクロエレクトロニクスの産業研究所
- 研究対象の半導体材料はインジウムリン(InP)窒化ガリウム(GaN)、ガリウム砒素(GaAs)、ガリウムアンチモン(GaSb)
- 欧州市場の開拓強化に向けた重要なマイルストーン

サムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」の第1期生に学位記が授与



京都工芸繊維大学
60周年記念館にて

- 2024年9月25日、第1期生2名に学位記授与式を実施
- 本講座は材料科学分野の博士後期課程の研究者育成を目的として開講
- 日本の材料科学の発展、企業の研究者・技術者の育成、グローバルな産業競争力の強化を目的にベテラン社員をリスキング
- 人材育成を通じて、日本の産業界の科学力向上に貢献

ALE（原子層エッチング）装置の販売を開始



- 窒化ガリウム (GaN) 系パワーデバイスの加工用途
- 従来のエッチング装置よりも更に微細なナノメートル (10^{-9} メートル) レベルの加工制御が可能
- 国内研究機関に複数台納入予定、海外からの問い合わせも増加

25/7月期事業計画

(2024.8.1 ~ 2025.7.31)

中期経営計画 目標数値

(単位:百万円)

	24/7月期 実績	25/7月期 計画		
		上半期 実績	下半期 計画	通期
売上高	8,203	4,121	5,379	9,500
売上総利益	4,193	2,016	2,594	4,610
営業利益	2,017	990	1,230	2,220
経常利益	2,088	1,011	1,229	2,240
当期純利益	1,471	714	816	1,530
海外売上高比率	46.3 %			42.1 %
ROE	12.6 %			11.9 %
1株当たり当期純利益(円)	183.25			190.48

下期見通し

用途	見通し
化合物半導体分野	半導体レーザーが堅調
シリコン半導体分野	欠陥解析が堅調、最先端技術研究や実装関連への展開を期待
電子部品分野	量子デバイス、各種センサー向けなど応用分野の広がり
ヘルスケア関連分野	ライフサイエンス向けで取組を継続
その他	共用設備、半導体教育設備向けなどが堅調
部品・メンテナンス	量産のお客様の生産量復調に期待

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

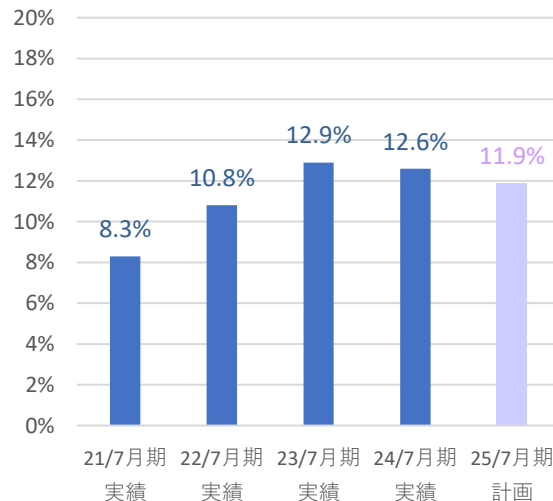
当社は、中長期的な経営指標として「装置製造原価率50%未満」「売上高営業利益率20%以上」「海外売上高比率50%以上」を掲げ、収益性と成長性を重視した経営の実現に向け対応しております。

当社の2024年7月期(第45期)のROEは12.6%であり、第46期には11.9%とする計画であります。また、「資本コスト」については、その概念や計算方法について統一的な基準が示されておらず、一般的な指標になっていないことより、当社の経営指標や開示情報には用いておりませんが、新規事業等への新たな投資については現状のROE水準を意識した経営を実践しております。

なお、当社の2024年11月1日時点のPBRは2.05倍となっており、株価についても意識した経営を継続いたします。

コーポレートガバナンス報告書(2024.11.13提出)より

ROEの実績(4期分)、計画(1期分)



株主アンケート結果のご報告

株主の皆様の声をお聞かせください



コエキク

株主アンケート概要

第45期年次報告書にて御案内した株主アンケートには、多くの株主様からご回答をいただき、厚く御礼を申し上げます。株主様から寄せられたご意見の一部をご報告いたします。いただきました貴重なご意見を今後の事業活動に活かしてまいります。

【調査対象】 全株主様

【株主数】 8,683名 (2025年1月31日時点)

【調査方法】 第45期年次報告書のQRコードより、株式会社プロネクサスが提供する『コエキク』機能にてご回答をいただきました。

【集計期間】 2024年10月23日～11月30日

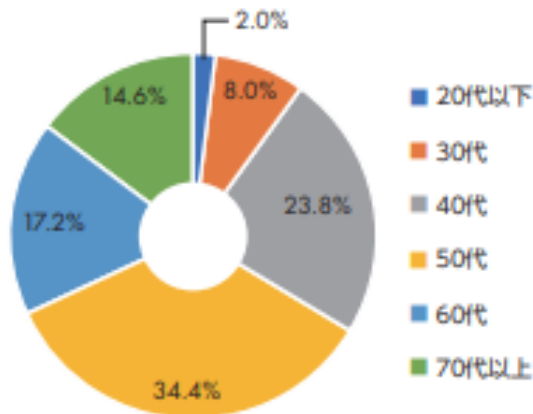


株主アンケート結果 ①

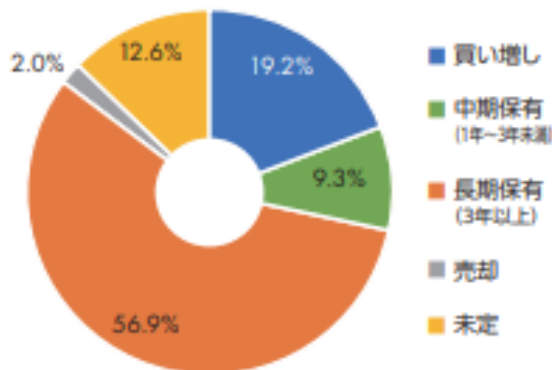
株主の皆様の声をお聞かせください



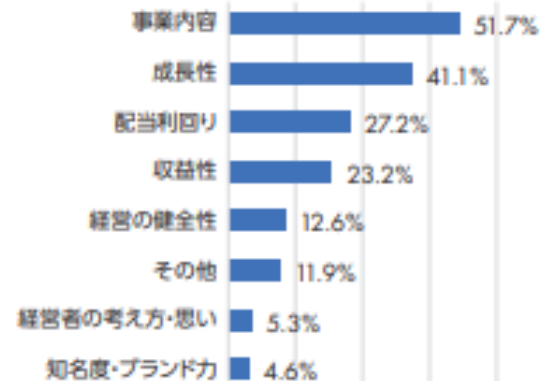
あなたの年齢をお知らせください。



当社の株式に対してどのような方針ですか？

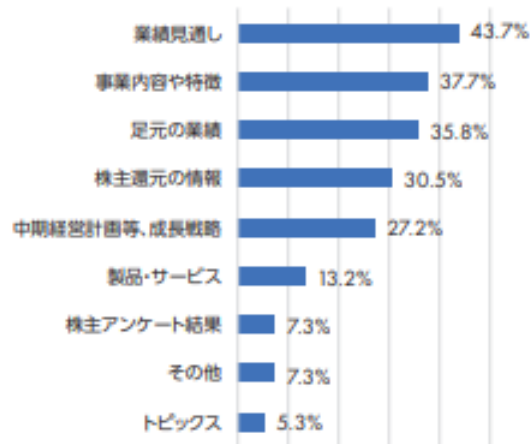


当社に投資する決め手となったポイントは何ですか？ (複数回答可)



株主アンケート結果 ②

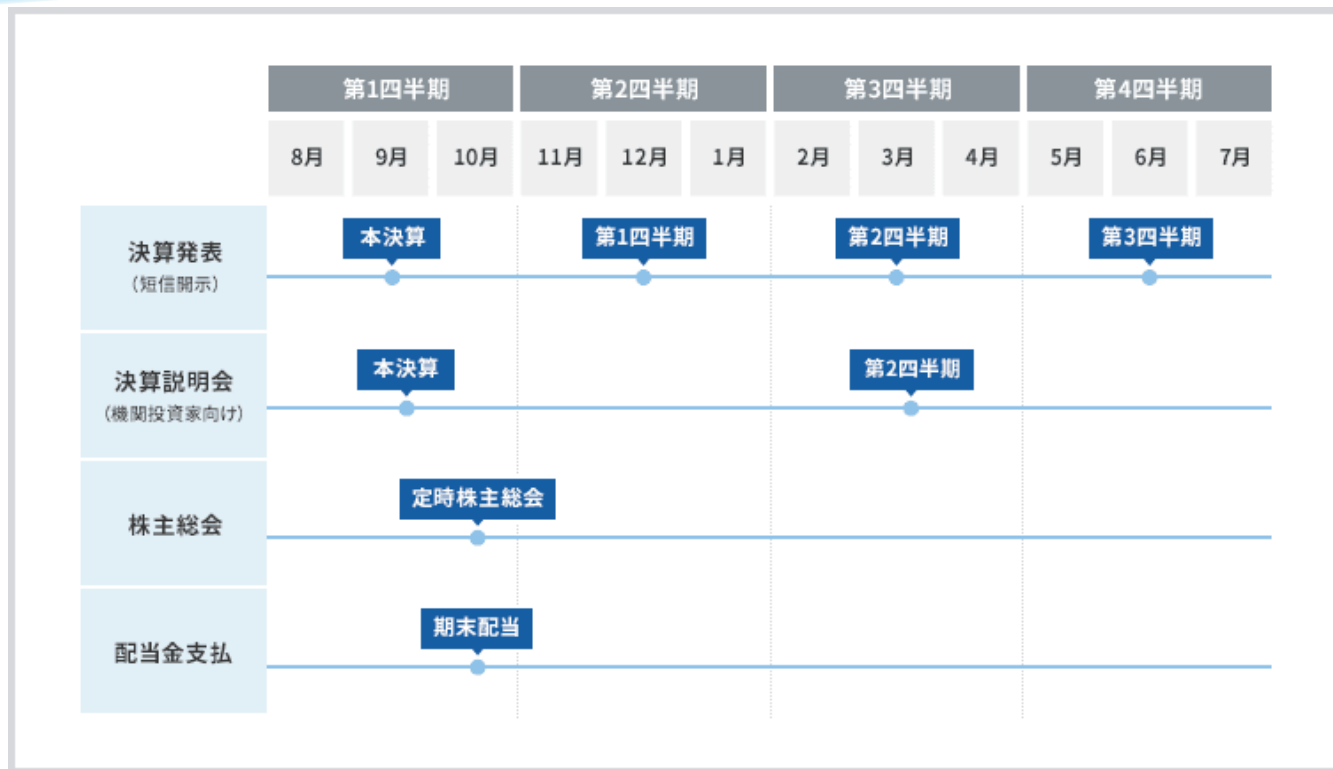
今後、年次報告書への記載を希望または
充実してほしい情報は何ですか？（複数回答可）



ご意見のご紹介（一部）

- ▶ プレゼント付きアンケートは今後も継続してほしい。
- ▶ いい人材の確保が会社の成長につながると考えます。人材に対する投資をお願いします。
- ▶ 配当性向の維持向上に期待します。
- ▶ ますます世の中に役立つ会社になっていってください。
- ▶ 安定成長と株主還元を期待します。
- ▶ 決算説明資料などで将来的な市場規模や成長見込みをもっと知りたい。
- ▶ 年次報告書のサムコの事業内容のページが、知らない人にわかりやすく伝えようという姿勢が感じられて良かった。
- ▶ 安心して保有できる会社だと思っています。これからもよろしくお願いします。
- ▶ 京都の会社らしく堅実かつ進歩的に頑張してほしい。

IRカレンダー



お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail : kikaku@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology

参考資料

会社概要

商号	サムコ株式会社 Samco Inc.
代表者	代表取締役会長兼CEO 辻 理(つじ おさむ) 代表取締役社長兼COO 川邊 史(かわべ つかさ)
設立	1979年(昭和54年)9月1日
本社所在地	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36
事業内容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
売上高	82億315万円(2024年7月期)
従業員	183名(2024年7月)
証券コード	6387(東京証券取引所プライム市場)



左:川邊 史、右:辻 理



最新の会社案内は[こちら](#)



当社のビジネスモデルは[こちら](#)

沿革(創業～2010年)

1979年9月	半導体製造装置の製造及び販売を目的として株式会社サムコインターナショナル研究所を設立
1980年7月	半導体プロセス用大型CVD(Chemical Vapor Deposition)装置の開発、販売を開始
1984年7月	東京都品川区に東京出張所(現東日本営業部)を開設
1987年2月	米国カリフォルニア州にオプトフィルムス研究所を開設
1997年11月	キリンビール株式会社と共同で、プラスチックボトルにDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)膜を形成する技術を開発
2001年5月	日本証券業協会に株式を店頭上場
2004年12月	株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ株式会社へ社名を変更
2010年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(2013年7月より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場



沿革の詳細は[こちら](#)

沿革(2011年～現在)

2013年7月	東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から市場第二部へ市場変更
2014年1月	東京証券取引所市場第二部から同第一部銘柄に指定
2014年5月	リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd.の株式90%を取得し子会社化(samco-ucp AGに社名変更)
2016年9月	Aqua Plasmaを用いたプラズマ洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始
2020年7月	第二生産技術棟内にCVD装置のデモルームを開設
2021年12月	電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH TM 」の販売を開始
2022年3月	第二研究開発棟内にナノ薄膜開発センターを立ち上げ
2022年4月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行



沿革の詳細は[こちら](#)

国内拠点、海外拠点



京都地区



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟

上記に加えて研究開発用の新棟を建設中（2025年春に稼働予定）



海外営業・サービス拠点(計11拠点)

海外売上高比率46.3%(2024年7月期末実績)

現地の営業・サービス人員を強化し、海外市場の開拓を図る。

⇒インド・ベンガルールオフィスを開設(2022年7月)

各事業拠点の詳細は[こちら](#)

経営理念、経営方針

Mission

経営理念

- 企業の永続的な発展を追求し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者とともに成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。

経営方針

1. 社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。
2. 直販体制を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。
3. 事業が社会に果たす役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

グローバル中堅企業

Vision

サムコの目指すグローバル中堅企業

1. 世界中で自由にビジネスを展開し、自社の独自技術を活かし、質の高い製品とサービスを提供し続ける。
2. コア技術(薄膜技術)をベースに、参入障壁の高い領域において、特定の製品で圧倒的シェアを有することで、自ら製品に値付けが出来る力を持ち、高い収益率を維持し続ける。
3. 売上の規模を求めるだけでなく、継続的に利益を稼げる市場に特化、集中する。
4. 組織体制は少数精鋭のプロ集団である。
5. 適正な税金を納め、国家や地域の発展にも貢献する。

製品ラインナップ



deposition

■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



etching

■ドライエッチング装置

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置



surface
treatment

■ドライ洗浄装置

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー

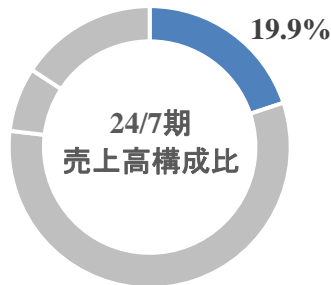


品目別売上高 CVD装置



装置ラインナップ

- ・ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- ・プラズマCVD装置
- ・液体ソースCVD®装置



概要

反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS (Liquid Source)-CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能であります。

2015年12月から販売を開始した原子層堆積装置 (ALD = Atomic Layer Deposition) はCVD装置に分類しております。ALD装置は、反応室に有機金属原料と酸化剤を交互に供給し、表面反応のみを利用して成膜を行う装置であり、高い膜厚制御性と良好な段差被覆性を実現することが可能であります。

第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



CVD装置の詳細は[こちら](#)



CVD装置とは [⇒こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 エッチング装置



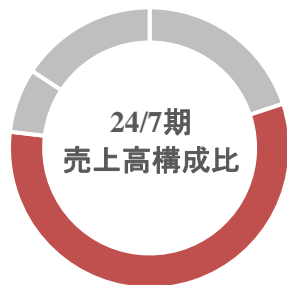
装置ラインナップ

- ・ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- ・シリコン深掘り装置
- ・RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- ・XeF2ドライエッチング装置

概要

各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP (Inductively Coupled Plasma=高密度プラズマ) を利用するエッチング装置では、高密度プラズマを安定して生成し、高速で高精度の微細加工が可能です。

第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



56.9%



エッチング装置の詳細は[こちら](#)



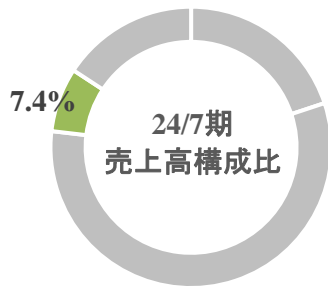
エッチング装置とは [⇒こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 洗浄装置



装置ラインナップ

- ・Aqua Plasma® クリーナー
- ・プラズマクリーナー
- ・UVオゾンクリーナー



概要

実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウエット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能であります。

2016年9月より販売を開始した水蒸気(H₂O)を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma(アクアプラズマ)洗浄装置は、金属酸化膜の還元、有機汚れの洗浄、樹脂接合、超親水化などの表面処理を、安全で環境に優しく行うことが可能であります。 第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より



洗浄装置の詳細は[こちら](#)



洗浄装置とは [⇒こちら](#)

(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 部品・メンテナンス

主な内訳

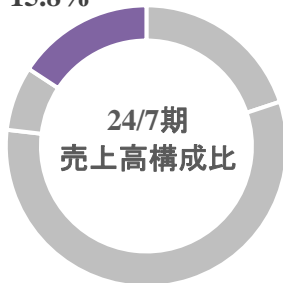
- ・部品、消耗品
- ・修理、改造
- ・移設、作業
- ・メンテナンス

概要

当社装置の納品後のアフターサービスに係る売上を、部品・メンテナンスの売上高として計上しております。交換用の部品や消耗品をはじめ、装置の修理や改造、また装置の移設やそれに伴う作業費、メンテナンス費用等があります。

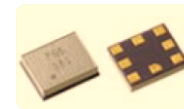
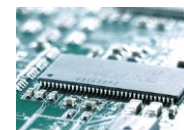
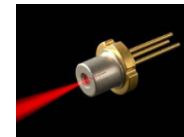
第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より

15.8%



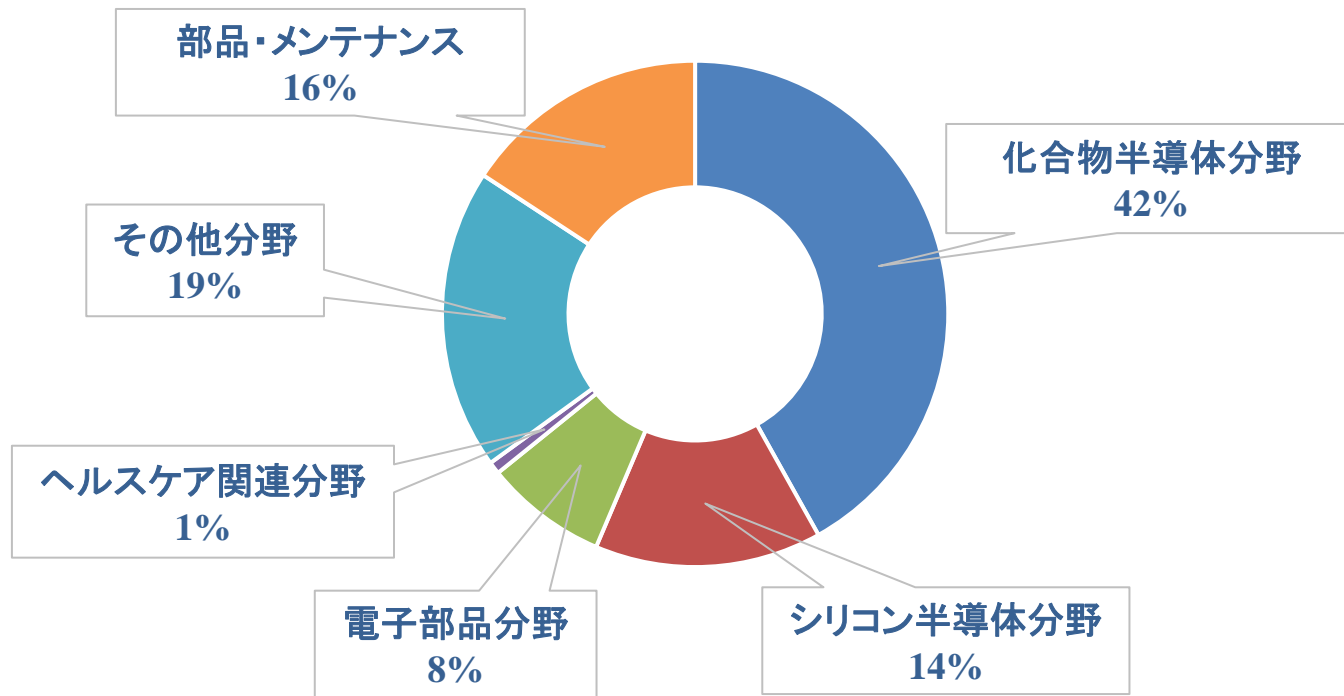
用途別売上高区分

用途	概要
化合物半導体分野	GaN(窒化ガリウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、InP(インジウムリン)、SiC(炭化シリコン)などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途です。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT(High Electron Mobility Transistor)などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途です。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途です。主にMEMS(Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途などです。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途です。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。



第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より

用途別売上高構成比（2024年7月期 実績）



当社製品が用いられるアプリケーション(例)



MEMS



TSV



SiCパワーデバイス

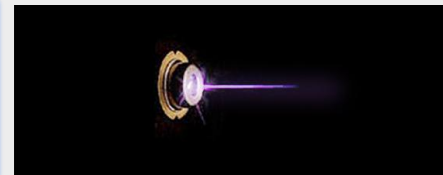


GaNパワーデバイス



LED

様々なアプリケーションの製造工程に
当社の製品が使用されています。



半導体レーザ(LD)



光導波路



フォトニック結晶



GaAs高周波デバイス



SAWデバイス

事業領域 化合物半導体の例

化合物半導体は、複数の異なる元素を組み合わせて作ることで、シリコンのような単元素の半導体では実現できない特性を得ることができます。

高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っており、スマートフォンの高周波デバイスやLD、LED、次世代パワーデバイスなどの材料として利用されています。

デバイスの例	材料の例	最終製品・用途の例
LD(半導体レーザー)	GaAs、InGaAsP、InP	スマートフォン顔認証システム、自動車の自動運転システム、無線基地局・衛星、光通信
LED、マイクロLED	GaN、AlInGaP、GaP	液晶ディスプレイ、照明、自動車ヘッドライト
パワーデバイス	SiC、GaN、Ga ₂ O ₃	鉄道車両インバーター、電気自動車の充電ユニット、データセンター、ノートパソコン等の急速充電器

地域別売上高区分

当社では、当社の製品が使用される地域(国)によって、売上高を以下の地域に区分しております。

地 域	対象となる国
日 本	日本国内
アジア	台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド ほか
北 米	米国、カナダ、メキシコ
欧 州	ブルガリア、ドイツ、イギリス、フィンランド、ポルトガル、スペイン、イタリア、トルコ、スウェーデン ほか
その他	オーストラリア、エジプト ほか

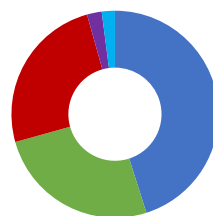
当社 第45期有価証券報告書(2024.10.22提出)より

株式の状況 (2025年1月末時点)

- ・発行可能株式総数 14,400,000株
- ・発行済株式の総数 8,042,881株
- ・株主数 8,683名
- ・大株主の状況

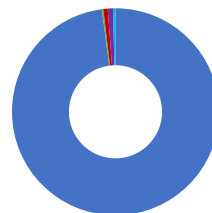
株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	946,000	11.8
辻 理	863,807	10.7
サムコエンジニアリング株式会社	850,282	10.6
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	250,700	3.1
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	157,200	2.0
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
立田 利明	103,099	1.3
三菱UFJキャピタル株式会社	102,931	1.3

所有者別株式分布状況 (株式数ベース)



■ 個人・その他	3,625,582株	(45.1%)
■ 金融機関	2,058,100株	(25.6%)
■ その他の法人	2,009,151株	(25.0%)
■ 外国法人等	184,951株	(2.3%)
■ 金融商品取引業者	165,097株	(2.1%)

所有者別株式分布状況 (株主数ベース)



■ 個人・その他	8,499名	(97.9%)
■ 金融機関	21名	(0.2%)
■ その他の法人	59名	(0.7%)
■ 外国法人等	71名	(0.8%)
■ 金融商品取引業者	33名	(0.4%)

主要数値の変遷




	19/7月期	20/7月期	21/7月期	22/7月期	23/7月期	24/7月期	25/7月期 (予想)
売上高 (百万円)	4,936	5,869	5,746	6,401	7,830	8,203	9,500
営業利益 (百万円)	327	902	989	1,371	1,858	2,017	2,220
営業利益率 (%)	6.6	15.4	17.2	21.4	23.7	24.6	23.4
経常利益 (百万円)	305	927	1,044	1,481	1,927	2,088	2,240
当期純利益 (百万円)	215	634	755	1,052	1,366	1,471	1,530
総資産 (百万円)	10,784	11,274	12,069	13,379	14,795	16,116	—
自己資本 (百万円)	8,280	8,788	9,410	10,057	11,144	12,299	—
自己資本比率 (%)	76.8	77.9	78.0	75.2	75.3	76.3	—
ROE (%)	2.6	7.4	8.3	10.8	12.9	12.6	—
減価償却費 (百万円)	93	105	95	76	57	83	105
設備投資額 (百万円)	76	87	737	234	33	276	450
研究開発費 (百万円)	170	205	264	255	242	262	360
EPS (円)	26.84	79.01	94.09	131.07	170.07	183.25	190.48
配当金 (円)	20	25	30	35	45	45	45

ESG・サステナビリティ



持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～

 <p>環境</p>	<p>《気候変動・脱炭素への取り組み》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。 ・環境方針(2006年制定)に沿った取り組みを実施。 <p>《環境配慮型製品》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ・脱炭素を支えるLED、レーザー、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。 ・コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。 ・主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減
 <p>社会</p>	<p>《事業を通じた社会的価値の創造》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造 <p>《社会貢献、地域貢献》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動 ・京都市繊維大学への寄附講座、東高瀬川ビジネスコミュニティへの参画 ・従業員、会社からの寄付金活動。(日本赤十字社、京都大学ほかノウクライナ支援、能登半島地震義援金)
 <p>ガバナンス</p>	<p>《ガバナンス体制、ダイバーシティ》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役員12名中、社外役員6名(うち女性1名) ←2024年10月22日開催の定時株主総会にて承認 ・取締役会の実効性評価による改善、検討。 ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社が重点的に取り組むSDGs



上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。

TCFD対応

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)



G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。

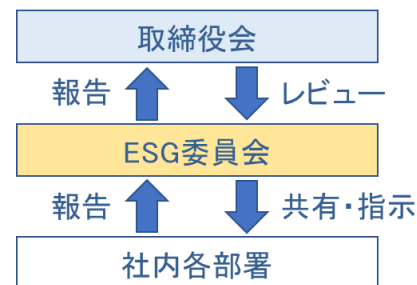
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。

ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。

⇒活動内容を取締役に年1回以上報告

⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

サムコとSDGsの関わり

- ・当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追究し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。







サムコのSDGsの取り組み例



	<ul style="list-style-type: none"> ・マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アクアプラズマ技術の寄与を目指す。 ・深紫外LED空気清浄機(コロナウィルス不活性化)製造に当社装置が寄与。 ・医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。 ・日本赤十字社への寄付。(ウクライナ人道危機救援金、能登半島地震災害義援金、トンガ大津波支援等)
	<ul style="list-style-type: none"> ・国内外の大学(ODA案件を含む)・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。 ・サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる若手研究者を支援。 ・京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。
	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。
	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC(炭化シリコン)、GaN(窒化ガリウム)、酸化ガリウム(Ga₂O₃)等の加工に当社装置が寄与。 ・高効率LED素子、マイクロLEDや、LD(レーザー)の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。
	<ul style="list-style-type: none"> ・当社はファブライツ企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。 ・勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。 ・役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。 ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

サムコのSDGsの取り組み例



 <p>9 産業と技術革新の基盤をつくろう</p>	<p>産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL(面発光レーザー)を含む通信用LD(レーザー)用装置の製造。 ・自動運転用のセンシング技術(LiDAR)、各種センサーや宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。 ・有機EL、マイクロLEDの製造。 ・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。
 <p>12 つくも責任 つかう責任</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。 ・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。 主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減
 <p>13 気候変動に具体的な対策を</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。 ・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
 <p>16 平和と公正をすべての人に</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。 ・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。

サムコの人材育成方針



1. 仕事は楽しく、面白くあるべきである。一所懸命に楽しく仕事をして、かつ面白い。そして良い結果がついてくる。そんな楽しく、面白い日々が日常である会社とする。
2. “学ぶ”を忘れない。学ぶことを常に念頭に置き、長きに渡り己を磨くことで自らの価値を高めてほしい。特に若手社員は30代までに能力向上に勤しむ癖をつけなければならない。
3. リスキリングにより第一線で活躍できるスキルを身に付けることにより、70歳まで働ける企業としていく。シニア社員が十分社会貢献できるよう再教育することを会社の使命と考える。
4. 外国籍社員の採用を増やし、若手社員の海外経験を増やすことによりグローバル人材の育成を図る。
5. 階層別の教育訓練制度(部長塾、課長塾、成長塾)を発展的に継続し、多角的な視野で経営管理できる人材の育成を図る。
6. たえず組織の新陳代謝を図り、新たな細胞(多様な人材)を積極的に登用していく。人事異動は社員の層を厚くし、組織を重層化する目的もあり、新たな能力の開拓につなげる。女性社員も大きな戦力として、管理職で活躍をしてもらえるように環境を整備する。



株主・投資家との対話状況

基本方針

当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話を行うこととしております。株主との対話につきましては、代表取締役社長 川邊 史の管掌の下、専任部署である広報・IR室(2024年7月現在3名)を中心に、経理部、総務部、社長室などの関連部署と密接に連携しつつ、IR活動を行っています。また、対話に際しては内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

対話を行った株主の概要 対象期間:2023年8月1日から2024年7月31日までの1年間

【機関投資家・アナリスト向け】

- ・1 on 1 ミーティング 123件 (国内95件、海外28件)、スモールミーティング 年3回
- ・機関投資家・アナリスト向け オンライン決算説明会 年2回 (Zoomウェビナー形式 / 中間期3月、期末9月)

【個人投資家向け】

- ・株主総会後の会社説明会 年1回 (10月)
- ・第44期 年次報告書 (2023年10月)にて株主アンケートを実施し、その結果を第45期 中間期報告書 (2024年4月)にて公表。
- ・個人投資家からの電話・メール問い合わせ対応 随時

投資家の皆様との建設的な対話を通じ、企業価値向上に繋げてまいりたいと考えております。

その他、対話の実例、取締役会に対するフィードバック、取り入れた事項などはHPに掲載 ⇒ [株主・投資家との対話状況の詳細はこちら](#)

IRカレンダー



お問い合わせ

サムコ 株式会社

経営企画室

E-mail : kikaku@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology